



即時發表

經辦代理:

David Moreno (大衛 穆銳農)  
**Open Sky Communications**  
電話: +1-415-519-3915  
電郵: [dmoreno@openskypr.com](mailto:dmoreno@openskypr.com)

### MICRON (美光科技) 加盟 THE EBEAM INITIATIVE

美國，加州，聖荷西，二零二零年二月二十五日—The eBeam Initiative，一個致力於推廣和宣導電子束技術在半導體製造全新應用的團體，今天宣佈，Micron 正式加入 eBeam Initiative。作為世界領先的半導體記憶體和存儲解決方案製造商，Micron 將為 eBeam Initiative 在半導體光罩和微影供給鏈教育活動帶來寶貴的觀點。

2009 年，the eBeam Initiative 正式成立，旨在半導體設計和製造業界為電子束技術教育平臺呼籲助力。The eBeam Initiative 利用年度會員意見調查和光罩製造商調查確定重要趨勢來幫助引導業界前行，以支持新電子束技術的引進。Micron 在 2019 年已經加入光罩製造商調查，現在成為 50 多家公司組織成員之一，the eBeam Initiative 會持續它的創立宗旨來加強業界的聯盟，促進電子束技術整體生態發展。

今天，在聖荷西會議中心舉辦的 SPIE 先進微影技術會議 (Advanced Lithography Conference) 期間，the eBeam Initiative 將與電子製造深度學習中心 (CDLe) 共同贊助下，主辦第十二屆年度成員會議。Micron 光罩技術部資深部長韋羅素博士 (Dr. Ezequiel Vidal-Russell) 將在會上做主題演講，涉及未來光罩和微影技術成功的重要課題，包括逆向微影 (ILT) 和曲線光罩在先進記憶體設計上的應用。講演稿將在二月二十五日後上傳至 the eBeam Initiative website at [www.ebeam.org](http://www.ebeam.org).

“電子束技術在半導體工業的發展中起著重要的作用，特別是在光罩製造和微影技術面臨各種全新挑戰的今天。The eBeam Initiative 會員的支援對喚起業界對新電子束技術的研發以保證半導體工業的持續發展有決定性的價值，對此我們衷心的感激他們的努力，” D2S 執行長藤村 (Aki Fujimura) 先生表示，D2S 是 eBeam Initiative 的主辦管理公司。“Micron 已經為我們年度光罩製造商調查提供了重要貢獻，我非常高興能宣佈他們成為我們最新的成員。他們的專業技能和獨特見識，將成為 the eBeam Initiative 重要的一員。”

**關於 The eBeam Initiative** (電子束倡議團)

The eBeam Initiative 是一個致力於推廣和宣導電子束技術在半導體製造全新應用的團體；為有關電子束技術的教育和促進活動提供相應的論壇。The eBeam Initiative 的目標是增加電子束技術應用在半導體製造各領域中的投資；降低電子束技術應用的障礙，能夠使更多積體電路設計完成，並且更快投進市場成為可能。

會員公司, 涵蓋整個半導體生態系統，包括:aBeam Technologies; Advantest; Alchip Technologies; AMTC; Applied Materials; Artwork Conversion; AseltaNanographics; ASML; Cadence Design Systems; Canon; CEA-Leti; D2S; Dai Nippon Printing; EQUIcon Software GmbH Jena; eSilicon Corporation; Fraunhofer CNT; Fujitsu Semiconductor Limited; GenISys GmbH; GLOBALFOUNDRIES; Grenon Consulting; Hitachi High-Technologies; HOLON CO., LTD; HOYA Corporation; imec; IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG; JEOL; KIOXIA; KLA; Maglen; Mentor, a Siemens Business; Micron Technology; Multibeam Corporation; NCS; NuFlare Technology; Petersen Advanced Lithography; Photonics; Sage Design Automation; Samsung Electronics; Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation (SMIC); STMicroelectronics; Synopsys; tau-Metrix; Tela Innovations; Tokyo Electron Ltd. (TEL); TOOL Corporation; Toppan Printing; UBC Microelectronics; Vistec Electron Beam GmbH; Xilinx and ZEISS. The eBeam Initiative 歡迎所有電子工業的公司和協會加盟。細節請查看 [www.ebeam.org](http://www.ebeam.org).

###